PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-222001 (43)Date of publication of application : 17.08.2001

(51)Int CL

G02F 1/1335 G02F 1/1368 G09F 9/00 H01L 29/786

(21)Application number: 2000-030021 (71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

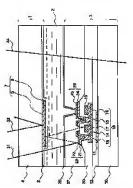
(22)Date of filing: 08.02.2000 (72)Inventor: YAMANAKA KAZUHIKO KATO TAKEHISA

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress leak current in a pixel transistor due to the influence of multiple reflection light on the surface of a metal wiring in a liquid crystal display device, to reduce the rise in the temperature of a liquid crystal panel and the resistance of the wiring and to prevent the deterioration in the picture quality of a projected image.

SOLUTION: In the liquid crystal panel produced by sealing a liquid crystal layer 2 between a driving device substrate 3 on which a pixel transistor 18 and metal wirings 23, 26 are formed and a counter substrate 1 on which a common transparent electrode film 8 and a black matrix film 7 are formed, the black matrix film 7 is composed of a metal film 5 in the entrance side of light having \geq 40% reflectance for a light of 380 to 680 nm wavelength and a metal film 6 on the exits side of light having \leq 40% reflectance for the light of 380 to 680 nm wavelength. The metal wiring 23, 26 are composed of metal films 21, 24 and low reflectance metal films 22, 25.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-222001 (P2001-222001A)

(43)公開日 平成13年8月17日(2001.8.17)

		Mark 177 FT		12/25.25
(51) Int.C1.7		織別記号	FΙ	テーマコード(参考)
G 0 2 F	1/1335	500	C 0 2 F 1/1338	5 500 2H091
	1/1368		C 0 9 F 9/00	313 2H092
G09F	9/00	3 1 3	G 0 2 F 1/136	500 5F110
H01L	29/786		H01L 29/78	612C 5G435
				616U
			審査請求 未請	求 請求項の数6 OL (全 9 頁)

(21) 出顧番号 特顧2000-30021(P2000-30021) (22) 出顧日 平成12年2月8日(2000.2.8) (71)出題人 00000:821 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 山中 一彦

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業

株式会社内

(72)発明者 加藤 剛久

大阪府高槻市宰町1番1号 松下電子工業 株式会社内

(74)代理人 100095555

A 100030000

弁理士 池内 寛幸 (外1名)

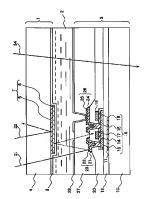
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 被晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 流晶表示装置において、金属配線表面での多 重反射光の影響による画素トランジスタのリーク電流を 即制すると共に、流晶パネルの温度上昇や配線抵抗を低 減して、投影映像の両質の劣化を防止する。

【解決手段】 画素トランジスタ18及び金配配線2 3、26か形成された駆動素子基板3と、共通透明電極 服8及びブラックマトリクス限了が形成された対向基板 1との間に流晶帽2を封入してなる液晶パネルにおい て、ブラックマトリクス膜7を、波長380~680 m での光反射率が40%以上である光入射機の金属階5 と、波長380~680 mでの光反射率が40%以下 である光出射側の金属機6とで構成し、金属配線23、 26を金属機21、24と低反射率金属機22、25で 構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 画素トランジスタおよび該画素トランジ スタに接続される金属記録が形成された駆動素子基板 と、共通透明電極およびブラックマトリクス膜が形成さ た対向基板との間に流晶層を封入してなる液晶パネル を有する液晶表示装置において、

前記ブラックマトリクス限は、波長380mmから68 0mか範囲で40%以上の光反射率を有する光入射側 の金属限と、波長380mmから680mmの範囲で4 0%以下の光反射率を有する光出射側の金属膜とからなる多層金属限で構成されていることを特徴とする液晶去 示装置

【請求項2】 前記金原原線は少なくとも3層の多層金 属限から情成され、前記多層金属側のうち光入射側およ び光出射線の少なくとも1つの金属膜が、後長380 n mから680 n m の範囲で40%以下の光反射率を有す る低反射率金属遮光膜からなる請求項1記載の液晶表示 装置。

【請求項3】 画素トランジスタおよび該画素トランジスタに接続される金原配線が形成されている駆動素子基板と、共通砂明値移はがブラックマトリクス限が形成された対向基板との間に流晶層を封入してなる液晶パネルを有する液晶表示装置とおいて.

前記金属配線は多層金属機から構成され、前記多層金属 機のうち光入射側の金属機が、波長380nmから68 0nmの範囲で40%以下の光反射率を有する低反射率 金属塗光機からなることを特徴とする液晶表示装置

【請求項4】 画素トランジスタおよび該画素トランジスタに接続される金属配線が形成された駆動素子基板と、共通透明電極およびブラックマトリクス膜が形成された対向基板との間に液晶層を封入してなる液晶パネルを有する液晶表示装置において、

前記金属配線は多層金属機から構成され、前記多層金属 機のうち光出射側の金属機が、波長380mから68 0mの範囲で40%以下の光反射率を有する低反射率 金属遮光機からなることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項5】 前記プラックマトリクス限は、波長38 の n m から680 n m の溶阻で40%以上の光反射率を 有する光之射側の金属限と、波長380 n m から680 n m の設押で40%以下の光反射率を有する光出射側の 金属限とからなる多層金属版で構成されている請求項3 または41融級が組み示状器の

【請求項6】 前記ブラックマトリクス膜における光出 射側の金属膜は、波長380mから600mの範囲 で20%以下の光反射率を有する請求項1から5のいず れか一項記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置およ びそれを用いた投射型映像表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、投射型の画像表示装置として、ア クティブマトリクス駆動方式の流晶パネルを使用した次 乱表示装置が開発されている。アクティブマトリクス駆動方式の液晶表示装置にあっては、画業スイッチング用 の画素トランジスタに直接光が入射してリーク電流が流 れ、それにより画質が劣化することを防止するために、 液晶層を挟んで、画素トランジスクが形成される配動素 子基板の反対側に配置される対向基板に、ブラックマト りクスと呼ばれるクロム版あるいはアルミニウム膜等で 形成した速度限が形成されている。この遮下膜は、画業 トランジスクと重なるように形成され、対向基板側から 入射される光が直接画素トランジスクに照射されないよう らにたっている。

【0003】一方、光によるリーク電流は、対向基板関 からの人射光のみならず、液晶パネルの裏面側に配置さ れた遮光接等で反射した光が、画素トランジスタに照射 されることが原因で流れることがある。このため、画素 トランジスタの下層側にも遮光瞬(以下、裏面遮光膜と 呼ぶりを設け、画素トランジスタに光が居いて画素トラ ンジスタにリーク電流が減れないような構成および方法 が、特開平3-5261 円分公報や特開平10-301 100号公線等で模案されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、光によるリープ電流は、対向基度側からの入射光や、裏面側からの入射光やなたらず、駆動素や基板の信替後やドレイン配線等の金属配線膜、裏面進光膜、およびブラックマトリクス膜等の金属膜で多重反射された光が、画素トランジスクに照射されることが成因で流れることがある。【00051 ここで、図4に示す従来の流晶表示装置の断面図を参照して、多重反射光の経路について説明する。

【0006】液晶表示装度は、対向基板1と駆動素子基 板3の解制に液晶層2が封入された液晶がれかと、その 入射側と出射側に配置された偏光板とにより構成され る。対向基板1は、透明基板4にブラックマトリクス膜 101を形成した後、共通透明電極膜8がブラックマト リクス膜101を覆うように透明基板4上に形成され 、構成されいる。

【0007】 駅勢素子基板3 は次のように構成されている。まず、石英基板10 に裏面遮光膜11 が形成され、この裏面遮光膜11 を有する元基板10 にに第10 原間絶縁膜12が形成されている。この第10 帰間絶縁膜12 が形成されている。この第10 帰間絶縁膜12 に乗りように第2の質問絶縁膜20 を形成し、画素トランジスタ18を運じる信号線102、およびドレイを提集103 を形成する。この信号線102、およびドレイを提集103 形成する。この信号線102、およびドレイを提集103 形成する。この信号線102、およびドレイを提集103 形成するこの信号線102 に対している。

20上に平坦化膜である第3の層間絶縁膜27を形成す

る。また、第3の層間絶縁膜27上には、透明電極膜2 8が形成される。したがって、上記画業トランジスタ1 8は、ブラックマトリクス膜101と裏両遮光膜11に よって挟まれた状態で形成されている。

【0008】ここで、ブラックマトリクス膜101は、 クロムもしくはアルミニウムで形成され、信号線102 およびドレイン配線103はアルミニウム等の低抵抗金 属で形成される。

【0009】上記液晶表示装置を透過する入射光34 は、各画素における液晶層2で所定の偏光方向に偏光さ れることにより画像を形成することになり、映像に寄与 しない入射光32は、ブラックマトリクス膜101によ り反射されることになる。

【0010】一方、画素トランジスタ18へ到達する多 重反射光の原因となる光としては次の二つが考えられ る。それは、

② 信号線102もしくはドレイン配線103表面に照射され、信号線102もしくはドレイン配線103とブラックマトリクス膜101の間を多重反射する入射光31と。

② 石英基板10の表面もしくは出射側偏光板等で反射 し、信号線102もしくはドレイン面線103と裏面遮 光膜11の間を多重反射する反射光33である。

【0012】また、図5に示すように、ブラックマトリス膜101に用いられるクロムは入射光のおよそう0%を反射し、信号線1023よびドレイン面線103に 用いられるアルミニウムは入射光の90%を反射する。このため、ブラックマトリクス膜101で反射されず信号線1021よびドレイン電線103である全域配線膜(対連レた入射光31は、この全属配線膜の表面とブラックマトリクス膜101の表面との間を多重反射することになる、特に、トランジスタの部分やコンタート部分の上部の金属磁線膜は表面に凹凸を有するため、この部分に到達した光社さまぎまざり度に乱反射されることになる。これらの光は適能が入れていまります。これらの光は適能が入れていまります。これらの光は適能が入れていまります。

【0013】一方、反射光33も、入射光31と同様

に、石英基板 I 0の表面はよび出射側光学系で反射され る光がある角度分布を持っていることから発生する。つ まり、反射光33のうち、裏面電光膜 I 1 で選先されず 信号線 I 0 2 やドレイン配線 I 0 3 の金属配線膜の出射 側表面に刺液した光が、裏面電光膜 I 1 2 合脈配線膜と の間で多重反射し、画素トランジスタ I 8 に到達するこ とにかる。

【0014】このような入射光および反射光の多重反射 を防止する方法の一つとして、ブラックマトリクス膜1 01、信号線102、およびドレイン配線103を低反 射金鉱で形成し、光の反射を防止する方法が考えられ る。例えば、ブラックマトリクス膜101に関しては、 酸化クロ人等の金属で形成することが考えられ、信号線 102およびドレイン配線103等の金属配線に関して は、タングステンシリサイド等の金属で形成することが 考えられる。

【0015】しかしその場合、まずブラックマトリクス 限101に関していえば、例えば従来反射率約30%程 度であったクロムから反射率約15%程度の酸化クロム (図5を参照)に変えた場合、従来約50%程度の光が 吸収されていたものが、約85%程度の光が吸収される ことになり、液晶表示炎型の温度上昇による両質の劣化 が同題になる。また、金原直域限に関していえば、従来 のアルミニウムからタングステンシリサイドに変更する と配様抵抗が増加し、それに伴う画質の劣化が問題にな

る。 【0016】そこで、本発明の目的は、流晶表示装置お よびそれを用いた技射型表示装置において、流晶表示装 置の温度上昇や配線販抗の増加に伴う画質の劣化が生し ることなく、信号報はよびドイン配線な当時と九光が 多重反射するのを低減させ、これら多重反射光の影響に よる画素トランジスタのリーク電流を抑制し、画素トラ ンジスタの特性の安定化を図ることができる技術を提供 することにある。

[0017] 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明に係る第1の液晶表示装置は、画素トランジ スタおよび該画素トランジスタに接続される金属配線が 形成された駆動素子基板と、共涌透明電極およびブラッ クマトリクス膜が形成された対向基板との間に液晶層を 封入してなる液晶パネルを有する液晶表示装置であっ て、前記ブラックマトリクス膜は、波長380nmから 680nmの範囲で40%以上の光反射率を有する光入 射側の金属膜と、波長380nmから680nmの範囲 で40%以下の光反射率を有する光出射側の金属膜とか らなる多層金属膜で構成されていることを特徴とする。 【0018】前記第1の液晶表示装置において、前記金 属配線は少なくとも3層の多層金属膜から構成され、前 記多層金属膜のうち光入射側および光出射側の少なくと も1つの金属膜が、波長380nmから680nmの範 囲で40%以下の光反射率を有する低反射金属遮光膜からなることが好ましい。

【0019】また、上記目的を達成するため、本発明に 係る第2の液晶表示装置は、画素トランジスタおよび該 職業トランジスタに接続される金属組織が研究されてい る駆動素子基板と、共通適明電極およびブラックマトリ クス限が形成された対向基板との間に流品層を封入して なる液晶パネルを有する液晶表示装置であって、前記金 属配線は多層金属限から構造され、前記多角金属限のう も光入射線の金属限が、波接380 nmから680 nm の範囲で40%以下の光反射率を有する低反射金属遮光 服からなるとを特徴とする。

【0020】さらに、上記目的を達成するため、本発明 に係る第3の液晶表示装置は、画素トランジスタおよび 該画素トランジスタに接続される金属配線が形成された 駆動素子基板と、共通透明電極およびブラックマトリク ス膜が形成された対向基板との間に液晶層を封入してな 液晶パネルを有する液晶表示装置であって、前記金属 配線は多層金属膜から構成され、前記多層金属機のうち 光出射側の金属膜が、波長380 nmから680 nmの 範囲で40%以下の光度射率を有する低反射金属遮光膜 からなることを輸出とする

【0021】前記第23よび第3の液晶表示表置におい、 元、前記プラックマトリクス限は、波長380mから 680mmが組門で40%以上の光反射率を介する光入 射側の金黒限と、波長380mから680mmの範囲 で40%以下の光反射率を有する光出射限の金属膜とからなる多層金属膜で構成されていることが歩ましい。

【0022】また、前記等1から第3の液晶表示装置に おいて、前記ブラックマトリクス膜における前記光出射 側の金属腺は、波長380nmから600nmの範囲で 20%以下の光反射率を有することが好ましい。

【0023】これらの構成によれば、ブラックマトリクス 脱表面での反射率が従来の1/2以下、金属配線表面での反射率が従来の1/2以下になる。この元線、カックマトリクス 関本金属配線表面で反射した光が画素トランジスタのチャネル環域に配いても十分に小さいため、リークで流が発生しない。

【0024】さらに、ブラックマトリクス限の光入射側 の金属は従来と同様の高及射率を示すため、液晶表示装 高の温度が従来に比較して高くなることはなく、また、 金属配線においては従来に比較して抵抗最か高くなるこ とがないため、それに伴う画質の劣化も生じない。

[0025]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。

【0026】(第1の実施形態)図1は、本発明の第1 の実施形態に係る液晶表示装置の構成を模式的に示す部 分断面図である。

【0027】図1において、液晶表示装置は、駆動素子

基板3と対向基板1との間に流品層2を封入して構成されている。対向基板1にはブラックマトリクス限7が形成され、ブラッマトリクス限7は、光久料層の金属限である低反射率金属限5と光出射側の金属膜である低反射率金属限6の2層構造になった多層金属膜(以下、多層ブラックマトリクス限7と除する。)で構成されている。この5層ブラックマトリクス限7の作業が法としては、透明基板4上に高反射率金属限5 低反射率金属機6の順で素着形成し、エッチングにより所定の領域に多層ブラックマトリクス限7の所状を形成する。

【0028】高反射率金属膜5は、図5に示すように、 該展380nmから680nmの範囲で光反射率が40 %以上の金属であるアルミニウムもしくは27ロム等で形 成され、また、低反射率金属膜6は、波長380nmか ら680nmの範囲で光反射率が40%以下の金属であ る、例えばタングステンシリサイド等で形成される。

【0029】ここで、波長を380 nmから680 nm の範囲に限定するのは、液晶表示装置で使用される光の 波長がこの範囲内にあり、他の波長の光は液晶表示装置 にとって温度上界等の同題の原因にならないためであ る。

【0030】また、画素トランジスタ18の光リークに 寄与する光の波長が380nmから600nmの範囲に あれば、図5に示すように、波長380nmから600 mの範囲で光反射率か20%以下の金属である酸化ク 口ムを低反射率金属膜6に使用してもよい。

【0031】この多層ブラックマトリクス膜7を形成した後、共通透明電極8を多層ブラックマトリクス膜7と 透明基板4上に形成することにより、対向基板1が構成される。

【0032】一方、駆動素子基板3は次のように構成されている。まず、石炭基板10上に、東面面光明の15年板 形成し、この裏面遮光限112有する石炭基板10上に 第1の層間絶縁数12を形成する。この第1の層間絶縁 服12上に両素トランジスク18と容量繰19が形成さ わる。

【0033】画素トランジスタ18は、ソース領域1

3、チャネル領域14、ドレイン領域15、ゲート酸化 版16、ゲート線17を有する。画素トランジスタ18 を形成した後、画素トランジスタ18とに、第2の層間 絶縁限20を形成し、画素トランジスタ18のソース領 域13、ドレイン領域15に通じるように第2の層間急 基線にエンチングによりコンタトホールを形成する。 その後、金属限21、24、続いて低反射率金属限2

2、25をコンタクトホールおよび第2の層間絶縁膜上 に形成し、エッチングにより信号線23、ドレイン配線 26を形成する。

【0034】ここで、金属膜21、24には、アルミニウム等の低抵抗金属を用い、低反射率金属膜22、25には、波長380nmから680nmの範囲で反射率が

40%以下である酸化クロム、チタン、チタンナイトラ イド、タングステン、タングステンシリサイド等の金属 を用いる。

【0035】信号線23およびドレイン配線26を形成 した後、この信号線23およびドレイン配線26を有す る第2の開間絶縁限20上に、平坦化像である第3の層 間絶縁限27を形成する。そして、この第3の層間絶縁 限27上に透明電係限28を形成することにより、駆動 素子振め3を構成する。

【0036]本実施形態に係る流晶表示装置によれば、 波長380nmから600nmの範囲で、多層ブラック マトリクス7表面での反射率が従来の1/2以下となり、信号線23およびドレイン電線26の金属極線表面 での反射率が従来の1/2以下となる。このため、多層 ブラックマトリクス膜7や信号線23やドレイン配線 6の金属高線表面で反射した光は従来の1/4以下となり、その光が画素トランジスタ18のチャネル領域14 に届いても十分に小さいため、リーク電流が発生することはない。

【0037】また、ブラックマトリクス膜7の入射光明 は従来の高反射率金属であり、入射光を余分に吸収する ことがないため、液晶表示装置の温度が従来よりも高く なることがない。

【0038】また、信号線23とドレイン配線26をア ルミコウム等の低低抗金属と低反射率金属の2層構造と することにより、配線の抵抗が高くなることなく、光反 射率を低減させることができる。

【0039】さらに、上記の液晶パネルにおいて、画素 トランジスタ18への多量反射光が十分に小さい場合、 ブラックマトリクス膜7と金属配線23、26表面のい ずれか一方のみに低反射率金属酸を形成してもよい。

【0040】(第2の実施形態) 図2は、本郷明の第2 の実施形態に係る液晶表示装置の構成を模式的は示す部 分断面図である。なお、第1の実施形態では、画業トラ ンジスタ18の信号線23とドレイン配線26の光入射 側にそれぞれ低反射率金配膜22、25を形成したのに 対して、本実施形態では、その光出射側にそれぞれ低反 財津金配膜を形成する。

【0041】図2において、駅動素子基板3 は次のよう に構成されている。まず、石英基板10上に、裏面直光 版11か野球され、この順直送脱11を有かる石英基 板10上に第1の帰間絶縁脱12が形成されている。こ の第10 所形成される。画素トランジスタ18を形成し た後、画素トランジスタ18上に、第2の桐間絶縁限2 0を形成し、画素トランジスタ18に第2の帰間絶縁限2 に対して可域15に通じるように第2の帰間絶縁取2 にエッチングによりコンタクトホールを形成さる。

【0042】その後、低反射金属膜42、45、続いて 金属膜41、44をコンタクトホールおよび第2の層間 絶縁膜上に形成し、エッチングにより信号線43、ドレイン配線46を形成する。

【0043】ここで、低反射金属限42、45には、20 5に示すように、波長380nmから680nmの範囲 で反射率が40%以下である確化クロム、チタン、チタ シナイトライド、タングステン、タングステンシリサイ ド等の金属を用い、金属膜41、44には、アルミニウ 大等の低低強金属を用いる。

【0044】【信号線43およびドレイン配線46を形成 した後、この信号線43およびドレイン配線46を育む 6第2の開間影線20上に、平坦化腺であ第3の層 開絶縁限27を形成する。そして、この第3の層間絶縁 服27上に透明電極限28を形成することにより、駆動 素子振阪26構成する。

【0045】本実施形態に係る液晶表示装置によれば、 続長380 n mから680 n mの範囲において、信号線 43およびドレイン配線46の光出射側での反射率が従 来の少なくとも1/2以下となる。このため、液晶表示 装置の石英基板10面および出射側光学系で反射した光 が、信号線43やドレイン配線46の金配属検索面およ び裏面遮光膜11で多重反射して、画素トランジスタ1 8のチャネル側域14に届いても十分に小さいため、リ 一分電流が平することはなか。

【0046】また、対向基係1のブラックマトリクス膜 7を、ブラックマトリクス膜7の光入時間の金属膜である 高反射率金属膜5と光出射側の金属膜である低反射率 金属膜6の2層構造を有する多層ブラックマトリクス膜 7とすることにより、同時にブラックマトリクス膜7と 金属配線43、46表面での多重反射光も低減できる。 反射率金属膜6に、酸化クロムを用いることにより、ブ ラックマトリクス膜7と金属配線43、46表面での多 重反射光を少なくとも光米の1/2にできるため、迷光 による画面のみ化を伝統することができる。

【0048】(第3の実施形態)図3は、本発明の第3 の実施形態に係る液晶表示装置の構成を模式的に示す第 が折面図である。なお、第13よび第2の実施形態で は、それぞれ、画素トランジスタの金属配線膜を、光入 射側の低反射率金属膜22、25と低低抗金属限21、 24、および低低抗金属降41、44を光出側の低反 射率金属膜42、45からなる2層構造としたのに対し て、本実施形態では、低反射率金属膜、低低抗金属膜、 および低反射率金属膜が33層積差としたのに対し なよび低反射率金属膜が33層積差としたのに対し が3よび低反射率金属膜が42×3層積差としたのに対し が3よび低反射率金属膜が42×3層積差とも32

【0049】図3において、駅動素子基板3は次のよう に構成されている。まず、石英基板10上に、裏面選先 版11が現成され、この裏面選光版11と存する石英基 板10上に第1の層間絶縁膜12が形成されている。こ の第10層間絶縁膜12上に画素トランジスタ18と窓 量線19が形成される。画素トランジスタ18と形成 た後、画素トランジスタ18上に、第2の層間絶縁膜2 0を形成し、画素トランジスタ18のソース領域13、 ドレイン領域15に通じるように、第2の層間絶縁膜2 0にエッチングによりコンタクトホールを形成する。

【0050】その後、金属数51、55をそれぞれ低反 射率金属膜50、52および54、56によりサンドイ ッチして3層構造にしたものをコンタクトホールおよび 第2の層間絶縁膜20上に形成し、エッチングにより信 号線53、ドレイン配線57を形成する。

【0051】にこで、低反射率金属限50、52、5 4、56には、波長380 n mから680 n mの範囲で 反射率が40%以下である酸化クロム、チタン、チタン ナイトライド、タングステン、タングステンシリサイド 等の金属を用い、金属限51、55には、アルミニウム 等の低低性を属を用いる。

【0052】信号線53およびドレイン配線57を形成 した後、この信号線53およびドレイン配線57を有す 6項2の同間始後線20上に、平坦化陸で36郊3の層 間絶縁膜27を形成する。そして、この第3の層間絶縁 膜27上に透明電極膜28を形成することにより、駆動 素子養板3を構成する。

【0053】本実絶形態に係る液晶表示共憲によれば、波長380nmから680nmの範囲において、信号終う38は5ドレイン配接57の光出射側対よび光入射側の反射率が少なくとも従来の1/2以下となる。このため、液晶表示装置の石英基板10面および出射側光学系で反射し、金属配線膜と裏面遮光膜11で多重反射する光を従来の1/2以下にし、かつブラックマトリクス膜7と金属配線膜53、57とでの多重反射光を従来の1/2以下にすることができるので、迷光が画素トランジス争18のチャネル領域14に届いて、それにより発生するリーク電流を低減することができる。

【0054】さらに、多層ブラックマトリクス膜7の低 反射率金属らに、酸化クロムを用いることにより、被長 380mから600mmや脱門で、多層ブラックマト リクス膜で、信号線53、およびドレイン電線57の表 面で多重反射する光を従来の少なくと61~4以下にす ることができ、液晶表示装置の画質の劣化を防止することができる。

[0055]

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置 の構成を模式的に示す部分断面図

【図2】 本発明の第2の実施形態に係る液晶表示装置 の構成を模式的に示す部分断面図

【図3】 本発明の第3の実施形態に係る液晶表示装置 の構成を模式的に示す部分断面図

【図4】 従来の液晶表示装置の構成を模式的に示す部分断面図

【図5】 金属に応じた波長に対する反射率の特性図

【符号の説明】

1 対向基板

2 液晶層

3 駆動素子基板

4 透明基板

5 高反射率金属膜

6 低反射率金属膜

7 多層ブラックマトリクス膜

8 共通透明電極膜 10 石英基板

11 裏面遮光膜

12 第1の層間絶縁膜

13 ソース領域

14 チャネル領域

15 ドレイン領域

16 ゲート酸化膜

17 ゲート線 18 画素トランジスタ

19 容量線

20 第2の層間絶縁膜

21 信号線23の金属膜 22 信号線23の低反射率金属膜

23 信号線

24 ドレイン配線26の金属膜 25 ドレイン配線26低反射率金属膜

20 ドレイン配線201 26 ドレイン配線

27 第3の層間絶縁膜

28 透明電極膜 31、32、34 入射光

33 反射光

41 信号線43の金属膜

42 信号線43の低反射率金属膜

43 信号線

44 ドレイン配線46の金属膜

45 ドレイン配線46の低反射率金属膜

46 ドレイン配線

50 信号線53の低反射率金属膜 51 信号線53の金属膜

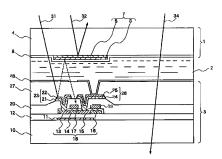
52 信号線53の低反射率金属膜 53 信号線

54 ドレイン配線57の低反射率金属膜

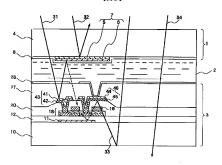
- 55 ドレイン配線57の金属膜
- 56 ドレイン配線57の低反射率金属膜
- 57 ドレイン配線

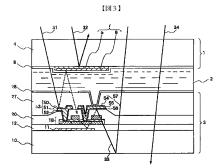
- 101 ブラックマトリクス膜
- 102 信号線
- 103 ドレイン配線

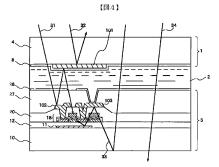
【図1】



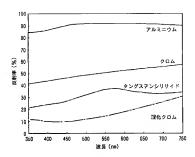
【図2】











フロントページの続き